高分子材料設計学研究室

<スタッフ>髙島 義徳(教授) 以倉 崚平(特任助教) 山岡 賢司(特任助教)

<研究のキーワード>

- (1) 特殊ネットワーク構築
- (2)材料機能創製
- (3)機能解析

- (4) 可逆性架橋
- (5) 可動性架橋
- (6) 力学・応答機能創製

<令和6年度の主な研究活動概要>

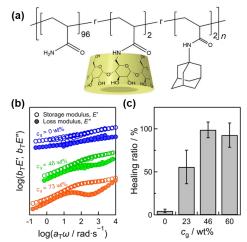
高分子材料の機能は、架橋設計に応じて多様に展開できる。本研究室では、独自 の架橋設計による機能創製を試みており、令和 6 年度は、以下の 4 項目の高分子材 料を作製し、新たな材料機能の創製を試みた。

(1) 可逆性架橋ゲルの粘弾性挙動の制御1

β-Cyclodextrin (βCD) と Adamantane (Ad)が形 成するホスト-ゲスト錯体を架橋点に導入した ゲルの粘弾性挙動を制御することで、強靭性や 自己修復性を向上できた。ホスト-ゲスト錯体 を可逆性架橋として導入したゲルを、水/グリ セリン混合溶媒の溶媒組成を変えて作製した (**図 1a**)。溶媒のグリセリン濃度 (c_s)が増加す ると、鎖の流動に由来する粘弾性挙動が観察さ れた (**図 1 b**)。 $c_{\mathfrak{g}}$ が増加すると β CD と Ad の 会合定数が低下し、鎖の運動性が向上したため である。鎖の運動性を高くすることで、自己修 復性を向上させることに成功した($\mathbf{図1c}$)。

(2) 環状分子添加による酵素反応分解の制御2

環境低負荷な生分解性高分子の分解性の制御 は高分子の資源循環において重要である。 に Cyclic phenylene sulfide(c[n]PS, 図 2b)を添 (d) 加することで Buffer 中の酵素反応分解性を制 御した。c[n]PS の空孔に PCL-PU が貫通した擬 ロタキサン構造 (図 2c)を作製することで分解 速度が低下した(**図 2d**)。添加した c[n]PS 間の π - π 相互作用によって酵素による PCL のエス テル結合の分解が抑制された(図 2e)。環状分 子の添加量と超分子構造の形成によって生分解 性高分子の分解速度を制御することに成功した。分解性に及ぼす c[n]PS の影響.



可逆性架橋ゲルの(a)化学構造. 図1. (b) 粘弾性挙動と(c)自己修復性のグリ セリン濃度(**c**_o)依存性.

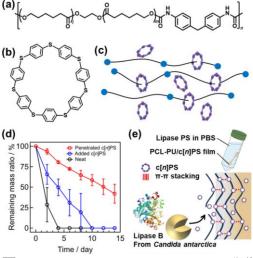


図2. (a) PCL-PU と(b) c[n]PS の化学 構造. (c) 擬口タキサン構造と(d) 酵素 反応分解実験の模式図。(e) PCL-PU の

(3) 可動性架橋を用いた再利用可能な粘着材料 3

粘着剤は柔軟なアクリル酸エステル共重合体に 化学架橋を導入することで最適な粘着特性となる よう設計される。しかし架橋によって溶解性を失 い、回収・リサイクルが困難であった。化学架橋 の代わりに可動性架橋を導入することで、粘着剤 としての実用強度と溶剤への溶解を両立すること に成功した。アセチル化 βCD モノマー(TAcβCD) と Ethyl acrylate (EA)からなる可動性架橋粘着剤 (M-PEA-TAcβCD, 図 3a)は、マイクロゲルとし て溶媒に溶解した。溶解した M-PEA-CD は、乾 燥後からみあいと可動性架橋を再形成して溶解前 と同じ粘着特性を示した(図 3b)。優れた粘着特 性は 10 回以上維持し、溶解と再形成を繰り返す ことでリサイクル粘着剤を実現した(図3c)。

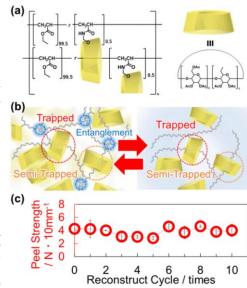
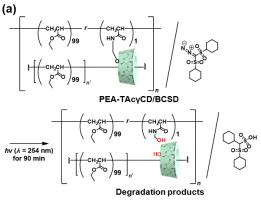


図 3. M-PEA-CD-TAcβCD の(a)化学構 造, (b)乾燥・溶解時の模式図および(c) リサイクル粘着特性.

(4) 可動性架橋を用いた光刺激応答性の易解体接着材料 4

近年、高い接着安定性と易解体性を兼ね備える接着剤の開発が求められている。 可動性架橋高分子材料に UV 照射により酸を発 (a) 生させる光酸発生剤を混合することで、光刺激 により架橋点を切断可能な高分子材料を作製し た。EA と酸分解性の結合を有するアセチル化 γCD モノマー(TAcyCD)を光酸発生剤である Bis(cyclohexyl sulfonyl) diazomethane (BSCD)存 在下で塊状重合することで、光分解性可動性架 橋材料(PEA-TAcyCD/BCSD)を得た(図 4a)。 PEA-TAcyCD/BCSD は、可動性架橋の導入によ り直鎖高分子(PEA)と比べて、高いヤング率と タフネスを示した。また、UV 照射により可動 性架橋点を切断することでヤング率が大きく減 少した (図 4b)。PEA-TAcyCD/BCSD を同種ま たは異種基板と接着させ、UV 照射により接着 強度を低下させることに成功した(図 4c)。可 動性架橋の導入に加え、光刺激での切断により 高い接着安定性と易解体性を両立した。



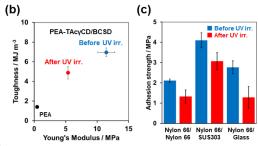


図4. (a) PEA-TAcyCD/BCSD の化学 構造. (b) UV 照射前後の力学物性の変 化. (c) UV 照射前後の接着強度の変化.

<参考文献>

- 1. Yamaoka, K.; Ikura, R.; Takashima, Y.; et al., *Polym*. *J.* **2024**, *56*, 1031-1039.
- 2. Ding, Y.; Ikura, R.; Yamaoka, K.; Takashima, Y.; et al., ACS Macro Lett. 2024, 13, 1265-1271.
- 3. Kosaba, S.; Ikura, R.; Yamaoka, K.; Takashima, Y.; et al., ACS Appl. Mater. Interfaces 2024, 16,
- 4. Matsumura, Y.; Yamaoka, K.; Ikura, R.; Takashima, Y.; et al., ACS Appl. Mater. Interfaces 2025, in press.